Japanese Patent Application Laid-Open (JP-A) No. 2001-117219

Publication Date: April 27, 2001

Application No.: 11-301240

Application Date: October 22, 1999

Applicant: FUJI PHOTO FILM CO., LTD.

TITLE: PHOTOSENSITIVE LITHOGRAPHIC PRINTING PLATE

ABSTRACT:

PURPOSE: To provide a photosensitive lithographic printing plate having sufficient sensitivity, ability to withstand repeated printing and stability of preservation.

CONSTITUTION: The photosensitive lithographic printing plate is characterized in that a photopolymerizing layer coating solution containing i) polyurethane resin binder and ii) a solvent and an addition-polymerizable compound having an unsaturated ethylene bond is applied to a support having a hydrophilic surface, with the coated support then heated and dried under conditions where the temperature of the photosensitive lithographic printing plate is maintained between 90°C to 140°C for at least 10 seconds. The photosensitive lithographic printing plate is preferably obtained by cooling the photosensitive lithographic printing plate to 50°C or below after drying, and thereafter further applying a protective layer containing a water-soluble oxygen-barring substance on the photopolymerizing layer, and then heating and drying the plate.

#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報 (A)

# (11)特許出願公開番号

# 特開2001-117219

最終頁に続く

(P2001-117219A) (43)公開日 平成13年4月27日(2001.4.27)

(51) Int. Cl	7	識別記号	FΙ		テーマコード (参考		
G03F	7/00	503	G03F 7/00	503	2H025		
B41N	1/14		B41N 1/14		2Н096		
G03F	7/027		G03F 7/027		2H114		
	7/035		7/035	7/035			
	7/11	501	7/11	501			
			審査請求	未請求 請求項の数	2 OL (全25頁)		
(21)出願番	号	<b>特願平11-301240</b>	(71)出願人 (	000005201			
			. 7	富士写真フイルム株式	会社		
(22)出願日		平成11年10月22日(1999.10.22)	7	神奈川県南足柄市中沼	7210番地		
			(72)発明者 /	小泉 滋夫			
			į į	<b>静岡県榛原郡吉田町川</b>	尻4000番地 富士写		
			J	真フイルム株式会社内	1		
			(72)発明者	岡本 安男			
			· 古	<b>静岡県榛原郡吉田町川</b>	尻4000番地 富士写		
		•	j	真フイルム株式会社内	1		
			(74)代理人 1	00073874			
			_	弁理士 萩野 平 (			

#### (54) 【発明の名称】感光性平版印刷版

#### (57)【要約】

【課題】 感度、耐刷性および保存安定性が十分な感光 性平版印刷版を提供する。

【解決手段】 親水性表面を有する支持体上に、i)ボリウレタン樹脂パインダー、ii)付加重合可能なエチレン性不飽和結合を有する化合物及び溶剤を含有する光重合層塗布液を塗布し、感光性平版印刷版の温度が90~140℃で10秒間以上保たれる条件で加熱乾燥することにより得られたことを特徴とし、好ましくは、該加熱乾燥後、感光性平版印刷版の温度を50℃以下に冷却したあと、引き続きその光重合層上に、水溶性の酸素遮断性物質を含有する保護層を塗布し、加熱乾燥することにより得られる。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 親水性表面を有する支持体上に、i)ボリウレタン樹脂パインダー、ii)付加重合可能なエチレン性不飽和結合を有する化合物及び溶剤を含有する光重合層塗布液を塗布し、感光性平版印刷版の温度が90~140℃で10秒間以上保たれる条件で加熱乾燥することにより得られたことを特徴とする感光性平版印刷版。

【請求項2】 前記加熱乾燥後、感光性平版印刷版の温度を50℃以下に冷却したあと、引き続きその光重合層 10上に、水溶性の酸素遮断性物質を含有する保護層を塗布し、加熱乾燥することにより得られたことを特徴とする請求項1に記載の感光性平版印刷版。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、感光性平版印刷版 に関し、特に感度、耐刷性および保存安定性に優れた感 光性平版印刷版に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来、感光性平版印刷版としては親水性 20 表面を有する支持体上に親油性の感光性樹脂を用いた P S版が広く用いられ、通常は、リスフィルムを介してマスク露光 (面露光)後、非画像部を溶解除去することにより所望の印刷版を得ていた。近年、画像情報をコンピュータを用いて電子的に処理、蓄積、出力する、ディジタル化技術が普及してきている。そして、そのようなディジタル化技術に対応した新しい画像出力方式が種々実用されるようになってきた。その結果レーザ光のような指向性の高い光をディジタル化された画像情報に従って走査し、リスフィルムを介することなく、直接印刷版を 30 製造するコンピュータ トゥ ブレート (CTP)技術が普及してきており、これに適応した感光性平版印刷版を得ることは重要な技術課題となっている。

【0003】このような走査露光可能な感光性平版印刷版を得る方式の一つとして、従来より、親水性支持体上に設ける感光性樹脂層として非常に感光スピードに優れた光重合性組成物の層を設け、さらに酸素遮断性の保護層を設けた構成が多く提案され、一部上市されている。使用される光重合性組成物は基本的にはエチレン性不飽和化合物、光重合開始剤、バインダー樹脂からなる。画40像形成は、光重合開始剤が光吸収し、活性ラジカルを生成、エチレン性不飽和化合物の付加重合を引き起こし、感光層の不溶化を生じるものである。しかしながら、上記のような感光性平版印刷版から製版された平版印刷版は、実用上十分に満足できる性能が得られないことがあった。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、感 度、耐刷性および保存安定性が十分な感光性平版印刷版 を提供することである。 [0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記目的を達成すべく鋭意検討を重ねた結果、ポリウレタン樹脂バインダーを含有する光重合層を90~140℃で加熱乾燥した感光性平版印刷版が、感度、耐刷性および保存安定性に優れていることを見出し、本発明を完成させたものである。

【0006】すなわち、本発明は以下の通りの感光性平版印刷版である。

- (1) 親水性表面を有する支持体上に、i) ポリウレタン樹脂バインダー、ii) 付加重合可能なエチレン性不飽和結合を有する化合物及び溶剤を含有する光重合層塗布液を塗布し、感光性平版印刷版の温度が90~140℃で10秒間以上保たれる条件で加熱乾燥することにより得られたことを特徴とする感光性平版印刷版。
- (2)前記加熱乾燥後、感光性平版印刷版の温度を50 で以下に冷却したあと、引き続きその光重合層上に、水 溶性の酸素遮断性物質を含有する保護層を塗布し、加熱 乾燥することにより得られたことを特徴とする前記
- (1)の感光性平版印刷版。

【0007】本発明の感光性平版印刷版が、感度、耐刷性および保存安定性に優れたものとなる理由は明確ではないが、該光重合層塗布液を塗布後、感光性平版印刷版の温度が90~140℃で10秒間以上保たれる条件で加熱乾燥することにより、該ボリウレタン樹脂バインダーのウレタン基同士の間に水素結合が形成され、この水素結合によって画像部樹脂層の硬化が促進され、感度および耐刷性が向上するものと考えられる。

【0008】また、上記の光重合層を設けた後、その上に水溶性の酸素遮断性物質を含有する保護層(以下、酸素遮断性層ともいう)を塗布する場合には、感光性平版印刷版の温度を50℃以下に冷却した後に行うことにより、塗布ムラのない状態で形成することができる。感光性平版印刷版の温度が50℃を超えた状態で、前記酸素遮断性層した場合には塗布ムラが生じ、酸素遮断性が悪くなる。

#### [0009]

【発明の実施の形態】以下、本発明の感光性平版印刷版について詳細に説明する。先ず、本発明の感光性平版印刷版において、特に重要な構成である光重合層の加熱乾燥条件について説明する。本発明の感光性平版印刷版において、後述の支持体上に後述の光重合層塗布液を塗布した後の加熱乾燥は、感光性平版印刷版の温度が90~140℃で10秒間以上保たれる条件で行うものである。

 することができる。支持体温度の測定方法としては、特 に限定されないが、i)支持体裏面に、直接、熱電対温 度センサーを貼り付けて測定する方法、ii)非接触放射 温度計で支持体裏面より測定する方法、iii)最高到達 温度によって変色するサーモテープを支持体裏面に貼り 付けて乾燥後、該サーモテーブの変色を確認する方法、 等が挙げられる。

【0011】上記i)の測定方法は、少量サンプル作成 実験等、感光性平版印刷版をバッチ的に作成する場合に は有効であるが、工業的な大量生産が行われる場合に は、長尺の支持体ウエッブが生産ライン上で絶えず移動 しているため、適用が困難である。上記のような工業的 な大量生産が行われる場合には、ii)およびiii)の方 法が有効である。なお、iii)の方法はあくまで最高到 達温度が示されるのみであるが、生産ライン上の過熱乾 燥工程におけるある程度の目安にはなる。また、最も正 確な温度測定方法はii)の方法である。

【0012】上記ii)の測定方法において用いられる非 接触放射温度計としては、特に限定されないが、堀場製 作所 (株) 製のCT-3100、RT50、RT50- 20 LX, RT-60-1, RT-60-2, IT-340S, IT-540N, IT-540S, IT-540 E、530 01、530 03、530 04、等が 挙げられる。

【0013】本発明の感光性平版印刷版の製造における 光重合層の加熱乾燥において、感光性平版印刷版の温度 を所定の温度範囲に保持する時間としては、10秒以上 であれば上限は特に限定されない。ただし、工業的な生 産ラインで大量生産が行われる場合には、可能な限り短 時間であることが好ましい。具体的には3分間以内が好 30 ましくは、より好ましくは2分間以内であり、さらに好 ましくは1分間以内である。以上のことから、上記の加 熱乾燥時における感光性平版印刷版の実際の温度とその 保持時間は、生産設備等によって適宜選択される。

【0014】また、上記の加熱乾燥をオーブン等の中で 行う場合には、オーブン等の加熱乾燥手段の設定温度を 感光性平版印刷版の該所定温度範囲よりも高めにする必 要がある。

【0015】次に、本発明の感光性平版印刷版の製造に 発明の感光性平版印刷版の製造において用いられる光重 合層塗布液は、i)ポリウレタン樹脂バインダーの少く とも1種、ii) 付加重合可能なエチレン性不飽和結合を 有する化合物の少くとも1種、光重合開始剤及び溶剤を 含有するものである。

【0016】i)ポリウレタン樹脂バインダー 上記光重合層塗布液に含有されるポリウレタン樹脂バイ ンダーとしては、水に不溶でアルカリ溶液に可溶なもの であれば特に限定されないが、酸性水素原子を持つ置換 基を有するポリウレタン樹脂であることが好ましい。な 50 素原子、炭素数1~8個のアルキルもしくはアルケニ

お該ボリウレタン樹脂バインダーにおける酸性水素原子 を持つ置換基とは、その水中での酸解離定数 (pKa) が7以下のものをさし、たとえば-COOH、-SO NHCOO-, -CONHSO, -, -CONHSO, N H-、-NHCONHSOz-などが含まれる。樹脂の 1 g 当りの酸含量は、0.05~6ミリ当量が好まし い。0.05ミリ当量より少ないとアルカリ現像液での 現像性が不十分となり、6ミリ当量より多いと耐摩耗性 が劣化してくる。好ましくは0.2~4ミリ当量であ 10 る。

【0017】イ)カルボキシル基を含有するポリウレタ ン樹脂

本発明に好適に使用されるポリウレタン樹脂としては下 記一般式(I)で表わされるジイソシアネート化合物 と、一般式(II)、(III)又は(IV)で表わされるカ ルボキシル基を有するジオール化合物との反応生成物を 基本骨格とするポリウレタン樹脂が含まれる。

[0018]

【化1】

$$HO-R_3-Ar-R_4-OH$$
 (III)  
 $R_5$   
 $I$   
 $COOH$ 

【0019】式中、R」は置換基(例えば、アルキル、 アルケニル、アラルキル、アリール、アルコキシ、ハロ おいて用いられる光重合層塗布液について説明する。本 40 ゲノの各基が好ましい。)を有していてもよい二価の脂 肪族又は芳香族炭化水素を示す。必要に応じ、R<sub>1</sub>中に イソシアネート基と反応しない他の官能基例えばエステ ル、ウレタン、アミド、ウレイド基、炭素-炭素不飽和 結合を有していてもよい。

> 【0020】R<sub>2</sub>は水素原子、置換基(例えば、アルキ ル、アリール、アルコキシ、エステル、ウレタン、アミ ド、ウレイド、ハロゲノの各基が好ましい。)を有して いてもよいアルキル、アルケニル、アラルキル、アリー ル、アルコキシ、アリーロキシ基を示し、好ましくは水

ル、炭素数 6 ~ 1 5 個のアリール基を示す。 R, 、 R, 、 R。はそれぞれ同一でも相異していてもよく、単結合、 置換基(例えば、アルキル、アルケニル、アラルキル、 アリール、アルコキシ及びハロゲノの各基が好まし い。)を有していてもよい二価の脂肪族又は芳香族炭化 水素を示す。好ましくは炭素数1~20個のアルキレ ン、炭素数6~15個のアリーレン基、更に好ましくは 炭素数1~8個のアルキレン基を示す。また必要に応 じ、R,、R,、R,中にイソシアネート基と反応しない 他の官能基、例えばエステル、ウレタン、アミド、ウレ 10 イド基、炭素-炭素不飽和結合を有していてもよい。な おR<sub>1</sub>、R<sub>1</sub>、R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>のうちの2又は3個で環を形成し てもよい。

【0021】Arは置換基を有していてもよい三価の芳 香族炭化水素を示し、好ましくは炭素数6~15個の芳 香族基を示す。一般式 ( I ) で示されるジイソシアネー ト化合物として、具体的には以下に示すものが含まれ る。即ち、2、4-トリレンジイソシアネート、2、4 - トリレンジイソシアネートの二量体、2, 6-トリレ ンジイソシアネート、pーキシリレンジイソシアネー ト、m-キシリレンジイソシアネート、4,4'-ジフ ェニルメタンジイソシアネート、1,5-ナフチレンジ イソシアネート、3,3′-ジメチルピフェニル-4, 4′-ジイソシアネート等の如き芳香族ジイソシアネー ト化合物; ヘキサメチレンジイソシアネート、トリメチ ルヘキサメチレンジイソシアネート、リジンジイソシア ネート、ダイマー酸ジイソシアネート等の如き脂肪族ジ イソシアネート化合物;イソホロンジイソシアネート、 4, 4'-メチレンピス(シクロヘキシルイソシアネー ト)、メチルシクロヘキサン-2,4(又は2,6)ジ 30 イソシアネート、1、3-(イソシアネートメチル)シ クロヘキサン等の如き脂環族ジイソシアネート化合物; 1, 3-ブチレングリコール1モルとトリレンジイソシ アネート2モルとの付加体等の如きジオールとジイソシ アネートとの反応物であるジイソシアネート化合物等が 挙げられる。

【0022】また一般式 (II) 、 (III) 又は (IV) で 示されるカルボキシル基を有するジオール化合物として は具体的には以下に示すものが含まれる。即ち、3,5 - ジヒドロキシ安息香酸、2,2-ビス(ヒドロキシメ 40 チル)プロピオン酸、2、2-ビス(2-ヒドロキシエ チル)プロピオン酸、2,2-ビス(3-ヒドロキシブ ロピル)プロピオン酸、ビス(ヒドロキシメチル)酢 酸、ビス(4-ヒドロキシフェニル)酢酸、4、4-ビ ス(4-ヒドロキシフェニル)ペンタン酸、酒石酸、 N, N-ビス (2-ヒドロキシエチル) -3-カルボキ シープロピオンアミド等が挙げられる。

【0023】口)カルボキシル基以外の酸性水素原子を 有するポリウレタン樹脂

また、カルボキシル基以外の酸性水素原子を有するポリ 50

ウレタン樹脂としては、一般式(I)のジイソシアネー ト化合物と、下記一般式(V)、(VI)、(VII)又は (VIII) のジオール化合物との反応生成物で表わされる 構造を基本骨格とするポリウレタン樹脂が含まれる。

[0024]

【化2】

【0025】式中、R<sub>2</sub>、R<sub>3</sub>、R<sub>4</sub>、R<sub>5</sub>及びArは前記 と同義である。R。は置換基(例えば、アルキル、アル コキシ、ハロゲノの各基が好ましい。) を有していても よい一価の脂肪族又は芳香族炭化水素を示す。好ましく は炭素数1~20個のアルキル又はアルケニル、炭素数 6~15個のアリール、炭素数7~15個のアラルキル 基を示す。更に好ましくは炭素数1~8個のアルキル、 又はアルケニル、炭素数6~10個のアリール基を示 す。YはN-スルホニルアミド基(-CO-NH-SO ,-)、N-スルホニルウレイド基(-NH-CO-N H-SO,-)、N-アミノスルホニルアミド基(-C 〇-NH-SO,-NH-) 又はスルホニルウレタン基 (-O-CO-NH-SO<sub>2</sub>-) を示す。

【0026】また一般式(V)、(VI)、(VII)又は (VIII) で示されるジオール化合物は、例えば一般式 (II)、(III)、(IV)で示されるカルボキシル基を 有するジオール化合物のヒドロキシ基を保護した後、塩 基存在下、一般式(IX)、(X)、(XI)又は(XII) の化合物との反応により合成される。更にクロロスルホ ニルイソシーネートと反応させた後、一般式(XIII)の アミン化合物と反応させることにより合成される。

[0027]

【化3】

【0028】式中、Xは塩素原子又は臭素原子を示す。 またスルホニルウレタン基の場合、トリヒドロキシ化合 10 ル化合物は、例えば、一般式 (XIV)と下記一般式 (X 物の1つのヒドロキシ基を一般式(IX)の化合物と反応 させることにより合成できる。また、一般式(X)の化 合物は、例えば、下記一般式 (XIV) と (XV) の化合物 の反応、一般式 (XI) の化合物は、下記一般式 (XVI) と(XV)の化合物の反応、一般式(XII)の化合物は、 下記一般式 (XVII) とクロロスルホニルイソシアネート の反応の後、一般式(XIII)のアミン化合物との反応に より、各々合成される。

$$X-R_4-SO_2-NH_2$$
  
 $X-R_4-NH_2$ 

【0032】具体的には一般式(V)、(VI)、(VI I) 及び(VIII) で示されるジオール化合物としては、 以下に示すものが含まれる。

[0033] 【化6】

【0030】また更に一般式(VIII)で示されるジオー VIII) の化合物の反応、一般式 (XVI) と下記一般式 (X VIII) の化合物の反応、一般式 (XVIII) とクロロスル ホニルイソシアネートの反応の後、下記一般式 (XIX) の化合物との反応により、各々得られた化合物をヒドロ キシル化することにより合成される。

[0031] 【化5】

(XIX)

$$\begin{array}{c} \text{CH}_{9} \\ \text{HO-CH}_{2}\text{CH}_{2} - \text{C--CH}_{2}\text{CH}_{2} - \text{OH} \\ \text{CO--NH--SO}_{2} - \text{CH}_{3} \end{array}$$

【化7】

[0034]

$$(No.8) \\ HO-CH_2CH_2-N-CH_2CH_2-OH \\ | \\ C=O \\ | \\ CH_2CH_2-CO-NH-SO_2-CH_3$$

[0035]

(No.12)

$$\begin{array}{c|c} \text{HO-CH}_2\text{CH}_2-\text{N--CH}_2\text{CH}_2-\text{OH} \\ & \\ \text{C=O} \\ & \\ \text{CH}_2\text{CH}_2-\text{COO--CH}_2\text{CO--NH--SO}_2- \end{array}$$

[0036]

【化9】

### (No.16)

# (No.17)

CH<sub>3</sub>

$$HO-CH_2-C-CH_2-OH$$

$$COO-CH_2CO-NH-SO_2-NH-C_2H_5$$

$$[\{ \pm 1 \ 0 \ ]$$

[0037]

(No.19)

(No.20)

(No.21)

$$CH_3$$
 | HO-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-OH | COO-C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>-NH-CO-NH-SO<sub>2</sub>-C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>

(No.22)

(No.23)

(No.24)

$$HO-C_3H_6CO-NH-SO_2-NH-C_2H_4-OH$$

【0038】ハ)その他のジオール化合物 本発明に使用されるポリウレタン樹脂は、より好ましく はさらに、ポリエーテルジオール化合物、ポリエステルジオール化合物、またはポリカーボネートジオール化合物の少なくとも1種との反応性生物で表される構造を有するポリウレタン樹脂である。ポリエーテルジオール化

合物としては、式(A)、(B)、(C)、(D)、

(E)で表される化合物、及び、末端に水酸基を有する エチレンオキシドとプロピレンオキシドのランダム共重 合体が挙げられる。

[0039]

【化11】

HO-
$$\{CH_2CH-O\}_a$$
H (A)

 $R^1$ 
HO- $\{CH_2CH_2CH-O\}_b$ H (B)

 $R^1$ 

$$HO + CH_2CH_2CH_2CH_2 - O + CC$$

$$HO - (CH_2CH_2 - O)_a + (CH_2CH_2 - O)_a + (D)$$
  
 $CH_3$ 

$$H - (OX)_{f} - O - (OX)_{g} - H$$
 (E)

【0040】(式中、R'は水素原子またはメチル基、 50 Xは、以下の基を表す。

[0042] a, b, c, d, e, f, gはそれぞれ2 以上の整数を示し、好ましくは2~100の整数であ

【0043】式(A)、(B)で表されるポリエーテル

【0044】すなわち、ジエチレングリコール、トリエ チレングリコール、テトラエチレングリコール、ペンタ エチレングリコール、ヘキサエチレングリコール、ヘブ タエチレングリコール、オクタエチレングリコール、ジ -1,2-プロピレングリコール、トリ-1,2-プロ ピレングリコール、テトラー1,2-プロピレングリコ ール、ヘキサー1、2ープロピレングリコール、ジー 1, 3-プロピレングリコール、トリー1, 3-プロピ レングリコール、テトラー1, 3ープロピレングリコー 20 ボールBPE-180、ニューボールBPE-2P、ニ ル、ジー1、3ープチレングリコール、トリー1、3-ブチレングリコール、ヘキサー1,3-ブチレングリコ ール、平均分子量1000のポリエチレングリコール、 平均分子量1500のポリエチレングリコール、平均分 子量2000のポリエチレングリコール、平均分子量3 000のポリエチレングリコール、平均分子量7500 のボリエチレングリコール、平均分子量400のポリプ ロピレングリコール、平均分子量700のポリプロピレ ングリコール、平均分子量1000のポリプロピレング リコール、平均分子量2000のポリプロピレングリコ 30 ール、平均分子量3000のポリプロピレングリコー ル、平均分子量4000のポリプロピレングリコール 等。

【0046】式(E)で示されるポリエーテルジオール 化合物としては、具体的には以下に示すものが挙げられ る。三洋化成工業(株)製ニューボールBPE-20、 ニューボールBPE-20F、ニューボールBPE-2 0NK、ニューボールBPE-20T、ニューボールB PE-20G、ニューボールBPE-40、ニューボー ルBPE-60、ニューボールBPE-100、ニュー ューボールBPE-23P、ニューボールBPE-3 P、ニューポールBPE-5P等。

【0047】末端に水酸基を有するエチレンオキシドと プロピレンオキシドのランダム共重合体としては、具体 的には以下に示すものが挙げられる。三洋化成工業

(株) 製ニューボール50HB-100、ニューボール 50HB-260、ニューボール50HB-400、ニ ューボール50HB-660、ニューボール50HB-2000、ニューボール50HB-5100等。

【0048】ポリエステルジオール化合物としては、式 (F)、(G)で表される化合物が挙げられる。 [0049] 【化13】

【0050】(式中、L'、L'およびL'はそれぞれ同 一でも相違してもよく2価の脂肪族または芳香族炭化水 素基を示し、L<sup>\*</sup>は2価の脂肪族炭化水素基を示す。好 ましくは、L¹、L¹、L¹はそれぞれアルキレン基、ア ルケニレン基、アルキニレン基、アリーレン基を示し、 L<sup>1</sup> はアルキレン基を示す。またL<sup>1</sup>、L<sup>1</sup>、L<sup>1</sup>中 にはイソシアネート基と反応しない他の官能基、例えば エーテル、カルボニル、エステル、シアノ、オレフィ ン、ウレタン、アミド、ウレイド基またはハロゲン原子 等が存在していてもよい。 n 1 、 n 2 はそれぞれ 2 以上 の整数であり、好ましくは2~100の整数を示す。) 50 キニレン基、アリーレン基を示す。またL'中にはイソ

【0051】ボリカーボネートジオール化合物として は、式(H)で表される化合物がある。

[0052]

【化14】

【0053】(式中、L'はそれぞれ同一でも相違して もよく2価の脂肪族または芳香族炭化水素基を示す。好 ましくは、L<sup>6</sup>はアルキレン基、アルケニレン基、アル

シアネート基と反応しない他の官能基、例えばエーテル、カルボニル、エステル、シアノ、オレフィン、ウレタン、アミド、ウレイド基またはハロゲン原子等が存在していてもよい。n3は2以上の整数であり、好ましくは $2\sim100$ の整数を示す。

【0054】式(F)、(G) または(H) で示される ジオール化合物としては具体的には以下に示すものが含まれる。具体例中のnは2以上の整数である。

[0055]

【化15】

(No. 25)
$$HO-CH_{2}CH_{2}-\left(O-C-CH_{2}CH_{2}-C-O-CH_{2}CH_{2}\right)_{n}-OH$$
(No. 26)
$$HO-CH_{2}CH_{2}-\left(O-C-\left(CH_{2}\right)_{4}-C-O-CH_{2}CH_{2}\right)_{n}-OH$$

(No. 27)  

$$HO - CH_2 -$$

(No. 28)  

$$HO - CH_2 -$$

$$\begin{array}{c} \text{(No.29)} \\ \text{HO-CH}_2 & \begin{array}{c} \text{O} \\ \text{-CH}_2 \\ \end{array} \\ \text{-CH}_2 & \begin{array}{c} \text{O} \\ \text{-CH}_2 \\ \end{array} \\ \text{-CO-CH}_2 & \begin{array}{c} \text{O} \\ \text{-CH}_2 \\ \end{array} \\ \text{-CO-CH}_2 & \begin{array}{c} \text{O} \\ \text{-CH}_2 \\ \end{array} \\ \end{array}$$

(No.31)  

$$HO - (CH_2)_4 + (O - C - O - (CH_2)_4)_n OH$$

[0056] [化16]

(No.33)

(No.34)

(No.35)

(No.36)

$$HO-CH_{2}- \left\{\begin{matrix} CH_{3} \\ CH_{2} \end{matrix} - \left\{\begin{matrix} CH_{2} \end{matrix} - \left[\begin{matrix} CH_{2} \end{matrix} - CH_{2} \right] \right] \right] \right]$$

【0057】ホ)ポリウレタン樹脂の合成

上記ポリウレタン樹脂は上記ジイソシアネート化合物お よびジオール化合物を非プロトン性溶媒中、それぞれの 反応性に応じた活性の公知な触媒を添加し、加熱するこ とにより合成される。使用するジイソシアネートおよび ジオール化合物のモル比は好ましくは0.8:1~1. 2:1であり、ポリマー末端にイソシアネート基が残存 した場合、アルコール類又はアミン類等で処理すること により、最終的にイソシアネート基が残存しない形で合 成される。上記ポリウレタン樹脂の分子量は、好ましく は重量平均で1000以上であり、更に好ましくは5, 000~15万の範囲である。

【0058】これらのポリウレタン樹脂は単独で用いて 30 も混合して用いてもよい。本発明の製造方法で得られる 感光性平版印刷版の光重合層中に含まれる、これらのポ リウレタン樹脂の含有量は約30~95重量%、好まし くは約50~90重量%である。

【0059】ii) 付加重合可能なエチレン性不飽和結合 を有する化合物

本発明の感光性平版印刷版の製造において用いられる光 重合層塗布液に含有される付加重合可能なエチレン性不 飽和結合を有する化合物(以下、付加重合性化合物とも いう) は、具体的には少なくとも一個のエチレン性不飽 40 和二重結合を有する付加重合性化合物であり、より詳細 には、末端エチレン性不飽和結合を少なくとも1個、好 ましくは2個以上有する化合物から選ばれる。この様な 化合物群は当該産業分野において広く知られるものであ り、本発明においてはこれらを特に限定無く用いる事が できる。これらは、例えばモノマー、プレポリマー、す なわち2量体、3量体およびオリゴマー、またはそれら の混合物ならびにそれらの共重合体などの化学的形態を もつ。モノマーおよびその共重合体の例としては、不飽

タコン酸、クロトン酸、イソクロトン酸、マレイン酸な ど) や、そのエステル類、アミド類が挙げられ、好まし くは、不飽和カルボン酸と脂肪族多価アルコール化合物 とのエステル、不飽和カルボン酸と脂肪族多価アミン化 合物とのアミド類が用いられる。

【0060】また、ヒドロキシル基や、アミノ基、メル カプト基等の求核性置換基を有する不飽和カルボン酸エ ステル、アミド類と単官能もしくは多官能イソシアネー ト類、エボキシ類との付加反応物、単官能もしくは、多 官能のカルボン酸との脱水縮合反応物等も好適に使用さ れる。また、イソシアナト基や、エボキシ基等の親電子 性置換基を有する、不飽和カルボン酸エステル、アミド 類と単官能もしくは多官能のアルゴール類、アミン類、 チオール類との付加反応物、ハロゲン基や、トシルオキ シ基等の脱離性置換基を有する、不飽和カルボン酸エス テル、アミド類と単官能もしくは多官能のアルコール 類、アミン類、チオール類との置換反応物も好適であ る。また、別の例として、上記の不飽和カルボン酸の代 わりに、不飽和ホスホン酸、スチレン、ビニルエーテル 等に置き換えた化合物群を使用する事も可能である。

【0061】脂肪族多価アルコール化合物と不飽和カル ボン酸とのエステルのモノマーの具体例としては、アク リル酸エステルとして、エチレングリコールジアクリレ ート、トリエチレングリコールジアクリレート、1,3 ーブタンジオールジアクリレート、テトラメチレングリ コールジアクリレート、プロピレングリコールジアクリ レート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、トリ メチロールプロパントリアクリレート、トリメチロール プロパントリ (アクリロイルオキシプロピル) エーテ ル、トリメチロールエタントリアクリレート、ヘキサン ジオールジアクリレート、1,4-シクロヘキサンジオ ールジアクリレート、テトラエチレングリコールジアク 和カルボン酸(例えば、アクリル酸、メタクリル酸、イ 50 リレート、ペンタエリスリトールジアクリレート、ペン

タエリスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリト ールテトラアクリレート、ジペンタエリスリトールジア クリレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレー ト、ソルビトールトリアクリレート、ソルビトールテト ラアクリレート、ソルビトールペンタアクリレート、ソ ルピトールヘキサアクリレート、トリ(アクリロイルオ キシエチル) イソシアヌレート、ボリエステルアクリレ ートオリゴマー等がある。

【0062】メタクリル酸エステルとしては、テトラメ チレングリコールジメタクリレート、トリエチレングリ 10 コールジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジメ タクリレート、トリメチロールプロパントリメタクリレ ート、トリメチロールエタントリメタクリレート、エチ レングリコールジメタクリレート、1,3-ブタンジオ ールジメタクリレート、ヘキサンジオールジメタクリレ ート、ペンタエリスリトールジメタクリレート、ペンタ エリスリトールトリメタクリレート、ペンタエリスリト ールテトラメタクリレート、ジペンタエリスリトールジ メタクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサメタク リレート、ソルビトールトリメタクリレート、ソルビト 20 ールテトラメタクリレート、ビス〔p-(3-メタクリ ルオキシー2-ヒドロキシプロポキシ)フェニル〕ジメ チルメタン、ビス- [p-(メタクリルオキシエトキ シ) フェニル] ジメチルメタン等がある。

【0063】イタコン酸エステルとしては、エチレング リコールジイタコネート、プロピレングリコールジイタ コネート、1,3-ブタンジオールジイタコネート、 1, 4-ブタンジオールジイタコネート、テトラメチレ ングリコールジイタコネート、ペンタエリスリトールジ る。クロトン酸エステルとしては、エチレングリコール ジクロトネート、テトラメチレングリコールジクロトネ ート、ペンタエリスリトールジクロトネート、ソルビト ールテトラジクロトネート等がある。

【0064】イソクロトン酸エステルとしては、エチレ ングリコールジイソクロトネート、ペンタエリスリトー ルジイソクロトネート、ソルビトールテトライソクロト ネート等がある。マレイン酸エステルとしては、エチレ ングリコールジマレート、トリエチレングリコールジマ レート、ペンタエリスリトールジマレート、ソルビトー 40 ルテトラマレート等がある。その他のエステルの例とし て、例えば、特公昭46-27926、特公昭51-4 7334、特開昭57-196231記載の脂肪族アル コール系エステル類や、特開昭59-5240、特開昭 59-5241、特開平2-226149記載の芳香族 系骨格を有するもの、特開平1-165613記載のア ミノ基を含有するもの等も好適に用いられる。さらに、 前述のエステルモノマーは混合物としても使用すること ができる。

【0065】また、脂肪族多価アミン化合物と不飽和力 50 の様な構造を用いるか、単独で使用するか併用するか、

ルボン酸とのアミドのモノマーの具体例としては、メチ レンピスーアクリルアミド、メチレンピスーメタクリル アミド、1,6-ヘキサメチレンピス-アクリルアミ ド、1、6-ヘキサメチレンピス-メタクリルアミド、 ジエチレントリアミントリスアクリルアミド、キシリレ ンピスアクリルアミド、キシリレンピスメタクリルアミ ド等がある。その他の好ましいアミド系モノマーの例と しては、特公昭54-21726記載のシクロヘキシレ ン構造を有すものをあげる事ができる。

【0066】また、イソシアネートと水酸基の付加反応 を用いて製造されるウレタン系付加重合性化合物も好適 であり、そのような具体例としては、例えば、特公昭4 8-41708号公報中に記載されている1分子に2個 以上のイソシアネート基を有するポリイソシアネート化 合物に、下記式(XX)で示される水酸基を含有するビニ ルモノマーを付加させた1分子中に2個以上の重合性ビ ニル基を含有するビニルウレタン化合物等が挙げられ る。

[0067]

 $CH_2 = C(R)COOCH_2CH(R')OH$ (XX)

(ただし、RおよびR´はHあるいはCH₂を示す。) 【0068】また、特開昭51-37193号、特公平 2-32293号、特公平2-16765号に記載され ているようなウレタンアクリレート類や、特公昭58-49860号、特公昭56-17654号、特公昭62 -39417、特公昭62-39418号記載のエチレ ンオキサイド系骨格を有するウレタン化合物類も好適で ある。

【0069】さらに、特開昭63-277653、特開 イタコネート、ソルビトールテトライタコネート等があ 30 昭63-260909号、特開平1-105238号に 記載される、分子内にアミノ構造やスルフィド構造を有 する付加重合性化合物類を用いることによっては、非常 に感光スピードに優れた光重合層を得ることができる。 【0070】その他の例としては、特開昭48-641 83号、特公昭49-43191号、特公昭52-30 490号、各公報に記載されているようなポリエステル アクリレート類、エポキシ樹脂と(メタ)アクリル酸を 反応させたエボキシアクリレート類等の多官能のアクリ レートやメタクリレートをあげることができる。また、 特公昭46-43946号、特公平1-40337号、 特公平1-40336号記載の特定の不飽和化合物や、 特開平2-25493号記載のビニルホスホン酸系化合 物等もあげることができる。また、ある場合には、特開 昭61-22048号記載のペルフルオロアルキル基を 含有する構造が好適に使用される。さらに日本接着協会 誌 vol. 20、No. 7、300~308ページ (198 4年) に光硬化性モノマーおよびオリゴマーとして紹介 されているものも使用することができる。

【0071】これらの、付加重合性化合物について、ど

23 添加量はどうかといった、使用方法の詳細は、最終的な 感光性平版印刷版の性能設計にあわせて、任意に設定で きる。例えば次のような観点から選択される。感光スピ ードの点では1分子あたりの不飽和基含量が多い構造が 好ましく、多くの場合、2官能以上がこのましい。ま た、光重合層の画像部すなわち硬化膜の強度を高くする ためには、3官能以上のものが良く、さらに、異なる官 能数・異なる重合性基(例えばアクリル酸エステル、メ タクリル酸エステル、スチレン系化合物、ビニルエーテ ル系化合物)のものを併用することで、感光性と、強度 10 を両方を調節する方法も有効である。大きな分子量の化 合物や、疎水性の高い化合物は感光スピードや、膜強度 に優れる反面、現像スピードや現像液中での析出といっ た点で好ましく無い場合がある。また、該光重合層中の 他の成分(例えば前述のバインダーポリマー、後述の光 重合開始剤(系)、後述の着色剤等)との相溶性、分散 性に対しても、付加重合性化合物の選択・使用法は重要 な要因であり、例えば、低純度化合物の使用や、2種以 上の併用により相溶性を向上させうる事がある。また、 後述の支持体、オーバーコート層等の密着性を向上せし 20 ジンとメロシアニン色素の系(特開昭54-15102 める目的で特定の構造を選択することもあり得る。該光 重合層中の付加重合性化合物の配合比に関しては、多い 方が感度的に有利であるが、多すぎる場合には、好まし く無い相分離が生じたり、光重合層の粘着性による製造 工程上の問題(例えば、光重合層成分の転写、粘着に由 来する製造不良)や、現像液からの析出が生じる等の問 題を生じうる。これらの観点から、好ましい配合比は、 多くの場合、光重合層の全成分に対して5~80重量 %、好ましくは25~75重量%である。また、これら は単独で用いても2種以上併用してもよい。そのほか、 付加重合性化合物の使用法は、酸素に対する重合阻害の 大小、解像度、かぶり性、屈折率変化、表面粘着性等の 観点から適切な構造、配合、添加量を任意に選択でき、 さらに場合によっては下塗り、上塗りといった層構成・ 塗布方法も実施し得る。

【0072】なお、本発明の感光性平版印刷版の製造に おいては、ウレタン結合基を有する付加重合性化合物 が、前記ポリウレタン樹脂バインダーとの相互作用が向 上すると考えられるため好ましい。

#### 【0073】iii)光重合開始剤

本発明の感光性平版印刷版の製造において用いられる光 重合層塗布液には、本発明の作用効果と直接因果関係は ないが、光重合開始剤を必須に含有するものである。本 発明において用いられる光重合層塗布液に含有される光 重合開始剤としては、使用する光源の波長により、特 許、文献等で公知である種々の光重合開始剤、あるいは 2種以上の光重合開始剤の併用系(光重合開始系)を適 宜選択して使用することができる。なお、本発明におい ては単独で用いる光重合開始剤、2種以上の光重合開始 剤を併用した系を総括して単に光重合開始剤または光開 50 クマリン系、ベンゾピラン系色素を用い、光重合開始剤

始剤ともいう。例えば400nm付近の光を光源として 用いる場合、ベンジル、ベンゾイルエーテル、ミヒラー ズケトン、アントラキノン、チオキサントン、アクリジ ン、フェナジン、ベンゾフェノン等が広く使用されてい

24

【0074】また、400nm以上の可視光線、Arレ ーザー、半導体レーザーの第2高調波、SHG-YAG レーザーを光源とする場合にも、種々の光重合開始剤が 提案されており、例えば、米国特許第2,850,44 5号に記載の、ある種の光還元性染料、例えばローズベ ンガル、エオシン、エリスロシンなど、あるいは、染料 と光重合開始剤との組み合わせによる系、例えば、染料 とアミンの複合開始系(特公昭44-20189号)、 ヘキサアリールビイミダゾールとラジカル発生剤と染料 との併用系(特公昭45-37377号)、ヘキサアリ ールビイミダゾールとpージアルキルアミノベンジリデ ンケトンの系(特公昭47-2528号、特開昭54-155292号)、環状シスーαージカルボニル化合物 と染料の系(特開昭48-84183号)、環状トリア 4号)、3-ケトクマリンと活性剤の系(特開昭52-112681号、特開昭58-15503号)、ピイミ ダゾール、スチレン誘導体、チオールの系(特開昭59 -140203号)、有機過酸化物と色素の系(特開昭 59-1504号、特開昭59-140203号、特開 昭59-189340号、特開昭62-174203 号、特公昭62-1641号、米国特許第4,766, 055号)、染料と活性ハロゲン化合物の系(特開昭6 3-178105号、特開昭63-258903号、特 開平2-63054号など)、染料とボレート化合物の 系(特開昭62-143044号、特開昭62-150 242号、特開昭64-13140号、特開昭64-1 3141号、特開昭64-13142号、特開昭64-13143号、特開昭64-13144号、特開昭64 -17048号、特開平1-229003号、特開平1 -298348号、特開平1-138204号など)、 ローダニン環を有する色素とラジカル発生剤の系(特開 平2-179643号、特開平2-244050号)、 チタノセンと3-ケトクマリン色素の系(特開昭63-221110号)、チタノセンとキサンテン色素さらに アミノ基あるいはウレタン基を含む付加重合可能なエチ レン性不飽和化合物を組み合わせた系(特開平4-22 1958号、特開平4-219756号)、チタノセン と特定のメロシアニン色素の系(特開平6-29506 1号)、チタノセンとベンゾピラン環を有する色素の系 (特開平8-334897号) 等を挙げることができ る。

【0075】好ましい光重合開始剤(系)は、色素とし て、シアニン系、メロシアニン系、キサンテン系、ケト

26 【0077】 (式中、Z'およびZ'はベンソイミダソー

ルまたはナフトイミダゾール環を形成するのに必要な非 金属原子群を表わし、同一でも異なっていてもよい。R

21、R21、R21 およびR21 はそれぞれ置換されていても

よいアルキル基を表わす。X<sup>-</sup>は対アニオンを表わし、

25

としてチタノセン化合物、トリアジン化合物を用いた組合せである。シアニン系色素として好ましくは下記の構造を有するものが挙げられるが、特に限定されない。

[0076]

【化17】

 $\mathbb{R}^{27}$  $R^{24}$  $\mathbb{R}^{25}$  $\mathbb{R}^{28}$ В C D X  $C_2H_5$  $C_2H_5$ C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>  $C_2H_5$ Cl Cl Cl Cl C.H. CoHE C2HA CoHs H CFs H CFs I  $(CH_{2})_{2}SO_{3}Na$   $C_{2}H_{5}$   $(CH_{2})_{2}SO_{3}^{-}$   $C_{2}H_{5}$  Cl Cl Cl Cl -

【0080】メロシアニン系色素として好ましくは下記の構造を有するものが挙げられるが、特に限定されない。

[0081] [化18]

$$R^{29} \cdot N - (CH = CH)_{h} \cdot C + L^{1} - L^{2} + C + CH - CH)_{h} \cdot C + L^{3} - L^{4} + L^{5} - L^{5} + C + CH - CH)_{h} \cdot C + CH$$

【0082】(式中、Z'、Z'はそれぞれシアニン色素で通常用いられる5員環及び/又は6員環の含窒素複素環を形成するに必要な非金属原子群を表わす。R' 、R' はそれぞれアルキル基を表わす。Q' とQ' は組み合わせることにより、4- チアゾリジノン環、5- チアゾリジノン環、4- オキサゾリジノン環、4- オキサゾリジノン環、5- イミダゾリジノン環、5- イミダゾリジノン環、5- イミダゾリジノ 40ン環または4- ジチオラノン環を形成するに必要な原子群を表わす。L'、L'、L' 及びL' はそれぞれメチン基を表わす。mは1又は2を表わす。i、hはそれぞれの又は1を表わす。lは1又は2を表わす。j、kはそれぞれ0、1、2又は3を表わす。X' は、対アニオンを表わす。)

[0083] [化19] 10 【0084】(式中R<sup>30</sup>およびR<sup>31</sup>は各々独立して水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アルケニル基、置換アルケニル基、アルカニル基、アルカール基、置換アルボニル基、アリール基、置換アリール基またはアラルキル基を表わす。Aは酸素原子、イオウ原子、セレン原子、テルル原子、アルキルないしはアリール置換された窒素原子、またはジアルキル置換された炭素原子を表わす。Xは含窒素ヘテロ五員環を形成するのに必要な非金属原子群を表わす。Yは置換フェニル基、無置換ないしは置換された多核芳香環、または無置換な

50 いしは置換されたヘテロ芳香環を表わす。 Z は水素原

子、アルキル基、置換アルキル基、アリール基、置換ア リール基、アラルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ 基、アリールチオ基、置換アミノ基、アシル基、または アルコキシカルボニル基を表わし、Yと互いに結合して

【0085】以下にメロシアニン系色素の具体例を示 す。

[0086]

[0087] 【化21】

【0088】キサンテン系色素としては、ローダミン B、ローダミン6G、エチルエオシン、アルコール可溶性エオシン、ピロニンY、ピロニンB等を挙げることができる。

【0089】ケトクマリン系色素として好ましくは下記の構造を有するものが挙げられるが、特に限定されない。

[0090] [化22]

【0091】(式中、 $R^{32}$ 、 $R^{33}$ および $R^{34}$ はそれぞれ 水素原子、ハロゲン原子、アルキル基又はアルコキシ基 を表わし、 $R^{34}$ および $R^{35}$ はそれぞれアルキル基を表わすが、少なくとも一方が炭素数  $4\sim 16$  個のアルキル基 40

を表わし、 $R^{37}$ は水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アシル基、シアノ基、カルボキシル基、もしくはそれのエステル誘導体またはアミド誘導体の基を表わし;  $R^{38}$ は炭素原子の総数が  $3\sim1$  7 個の複素環残基 $-CO-R^{39}$ を表わし、 $R^{33}$ と $R^{34}$ 、 $R^{38}$ と $R^{36}$ は互いに結合して環を形成してもよい。ここで $R^{39}$ は下に示す基である。)

[0092]

30 【化23】

【0093】以下にケトクマリン系色素の具体例を示す。

[0094]

【化24】

【0095】ベンゾピラン系色素として好ましくは下記の構造を有するものが挙げられるが、特に限定されない。

[0096] [化25]

【0097】(式中、 $R^3 \sim R^5$  はお互いに独立して、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アリール基、水酸基、アルコキシ基またはアミノ基を表す。また、 $R^3 \sim R^5$  はそれらが各々結合できる炭素原子と共に非金属原子から成る環を形成していても良い。 $R^7$  は、水素原子、アルキル基、アリール基、ヘテロ芳香族基、シアノ基、アルコキシ基、カルボキシ基またはアルケニル基を表す。 $R^5$  は、 $R^7$  で表される基または $-Z-R^7$  であり、Z はカルボニル基、スルホニル基、スルフィニル基またはアリーレンジカルボニル基を表す。また $R^7$  および $R^3$  は共に非金属原子から成る環を形成しても良い。AはO、S、N Hまたは置換基を有する窒素原子を表す。Bは、基

[0098] 【化26】

$$=C_{-G_1}$$

【0099】であり、G<sub>1</sub>、G<sub>2</sub>は同一でも異なっていて 50

も良く、水素原子、シアノ基、アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アシル基、アリールカルボニル基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基を表す。但しG、とG、は同時に水素原子となることはない。またG、およびG、は炭素原子と共に非金属原子から成る環を形成していても良い。)

【0100】以下にベンゾピラン系色素の具体例を示30 す。

【0101】 【化27】

40

【0102】光重合開始剤としてのトリアジン化合物と しては、次式の化合物を挙げることができる。

[0103]

【化28】

【0104】(式中、Halはハロゲン原子を表わす。  $Y^2 U - C (Hal)_3, -NH_2, -NHR^{21}, -N(R$ <sup>11</sup>),、-OR<sup>11</sup>を表わす。ここでR<sup>11</sup>はアルキル基、置 換アルキル基、アリール基、置換アリール基を表わす。 またR<sup>20</sup>は-C(Hal),、アルキル基、置換アルキ ル基、アリール基、置換アリール基、置換アルケニル基 を表わす。) で表わされる化合物。

【0105】以下にトリアジン化合物の具体例を示す。 [0106]

【化29】

ĊN

$$R - \bigvee_{N = \bigvee_{N = \bigcup_{CCI_3}} N} \bigvee_{CCI_3} V$$

$$\begin{pmatrix} \mathsf{R} = -\mathsf{CN}, -\mathsf{CF}_3, -\mathsf{SO}_2\mathsf{CH}_3, -\mathsf{SOCH}_3, -\mathsf{N}(\mathsf{CH}_3)_3^{\mathfrak{G}}, -\mathsf{S}(\mathsf{CH}_3)_2^{\mathfrak{G}} \\ -\mathsf{CI}, -\mathsf{Br}, -\mathsf{F}, -\mathsf{OCH}_3, -\mathsf{C}-\mathsf{CH}_3, -\mathsf{C}-\mathsf{OCH}_3 \\ \mathsf{II} \\ \mathsf{O} \\ \mathsf{O} \end{pmatrix}$$

【0107】また、好ましい光重合開始剤としては、チ タノセン化合物が挙げられる。チタノセン化合物として は、例えば、特開昭59-152396号、特開昭61 -151197号公報に記載されている公知の化合物を 適宜に選択して用いることができる。

【0108】更に具体的には、ジーシクロペンタジエニ ルーTi-ジークロライド、ジーシクロペンタジエニル - Ti-ビス-フェニル、ジーシクロペンタジエニルー Ti-ビス-2、3、4、5、6-ペンタフルオロフェ 50 4、5、6-ペンタフルオロフェニ-1-イル(以下A

ニ-1-イル(以下A-1と記す)、ジ-シクロペンタ ジエニルーTiーピスー2, 3, 5, 6ーテトラフルオ ロフェニー1ーイル、ジーシクロペンタジエニルーTi ービスー2、4、6ートリフルオロフェニー1ーイル、 ジーシクロペンタジエニルーTiービス-2,6-ジフ ルオロフェニー1ーイル、ジーシクロペンタジエニルー Ti-ビス-2、4-ジフルオロフェニ-1-イル、ジ -メチルシクロペンタジエニル-Ti-ビス-2、3、

- 2 と記す)、ジーメチルシクロペンタジエニルーTi ービス-2, 3, 5, 6ーテトラフルオロフェニー1ー イル、ジーメチルシクロペンタジエニルーTiービスー2, 4ージフルオロフェニー1ーイル、ビス(シクロペンタジエニル)ービス(2, 6ージフルオロー3ー(ピリー1ーイル)フェニル)チタニウム(以下A-3と記す)等を挙げることができる。

【0109】本発明で用いられる光重合層塗布液中のこれらの光重合開始剤の含有濃度は通常わずかなものである。また、不適当に多い場合には有効光線の遮断等好ま 10 しくない結果を生じる。本発明における光重合開始剤の量は、バインダー成分と付加重合性化合物成分との合計に対して0.01重量%から70重量%の範囲で使用するのが好ましい。より好ましくは、1重量%から50重量%で良好な結果を得る。

【0110】また、光重合開始剤にはアミン化合物、チオール化合物等の助剤を加えてもよく、特に好ましいものは下記一般式で表されるアミン化合物及びアミノ酸類である。

[0111]

【化30】

$$R^{11}$$
 N- $C$   $R^{13}$ 

【0112】(式中、 $R^s \sim R^{l^s}$ はそれぞれアルキル基を表わす。)

[0113]

【化31】

【0114】(式中、 $R^{13} \sim R^{21}$ は、アルキル、アルコキシを表し、 $R^{21}$ と $R^{23}$ は環を形成してもよく、 $R^{23}$ は複素環、アルキルチオを表す。)

[0115]

【化32】

【0116】(式中、 $R^{28}$ 、 $R^{29}$ は同一または異なり、置換基を有していても良く不飽和結合を含んでいても良い炭化水素基、あるいはヘテロ環基を表す。 $R^{26}$ 、 $R^{27}$ は同一または異なり、水素原子、置換基を有していても良く不飽和結合を含んでいても良い炭化水素基、ヘテロ環基、ヒドロキシル基、置換オキシ基、メルカプト基、置換チオ基を表わす。また、 $R^{26}$ 、 $R^{27}$ は互いに結合して環を形成し、-O-、 $-NR^{24}-$ 、-O-CO-、-NH-CO-、-S-、及び/又は、 $-SO_2-$ を環の連結主鎖に含んでいても良い炭素数 2 から 8 のアルキレン基を表す。 $R^{24}$ 、 $R^{23}$ は水素原子、置換基を有していても良く不飽和結合を含んでいても良い炭化水素基、或いは置換カルボニル基を表す。)

【0117】また、p-ジエチルアミノ安息香酸エチル20 等のジアルキル安息香酸エステル、4,4′-ビス(ジメチルアミノ)ベンゾフェノン等のビスアミノベンゾフェノン、4,4′-ビス(ジエチルアミノ)ベンジル等のビスアミノベンジル、

[0118] [化33]

(n)C<sub>6</sub>H<sub>17</sub>

【0119】 N-フェニルグリン、N-フェニルグリシ ンナトリウム塩が挙げられる。

【0120】なお、本発明の感光性平版印刷版の製造に おいては、光重合層塗布液を塗布した後の加熱乾燥温度 が90~140℃と、従前の製造方法に比べて若干高め であるため、光重合開始剤としても比較的熱安定性に優 れたものを用いることが好ましい。

【0121】本発明において用いられる光重合層塗布液 に含有される溶剤としては、特に限定されないが、アセ トン、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、酢酸エチ 40 ル、エチレンジクロライド、テトラヒドロフラン、トル エン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレ ングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコール ジメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエ ーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、ア セチルアセトン、シクロヘキサノン、ジアセトンアルコ ール、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテー ト、エチレングリコールエチルエーテルアセテート、エ チレングリコールモノイソプロピルエーテル、エチレン

シプロパノール、メトキシメトキシエタノール、ジエチ レングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコ ールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールジメチ ルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、 プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、 プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート、 3-メトキシプロピルアセテート、N、N-ジメチルホ ルムアミド、ジメチルスルホキシド、ィーブチロラクト ン、乳酸メチル、乳酸エチルなどが挙げられる。これら 10 の溶剤は、単独あるいは混合して使用することができ

【0122】また、本発明の製造で用いられる光重合層 塗布液には、バインダー成分として、上記ポリウレタン 樹脂バインダー以外のものを含有させることができる。 上記ポリウレタン樹脂バインダー以外に含有させてもよ いバインダー成分としては、例えばポリアミド樹脂、エ ポキシ樹脂、ポリアセタール樹脂、アクリル樹脂、メタ クリル樹脂、ポリスチレン系樹脂、ノボラック型フェノ ール系樹脂を挙げることができる。

【0123】本発明において用いられる光重合層塗布液 には、以上の基本成分の他に光重合層のための組成物の 製造中あるいは保存中において前記付加重合性化合物の 不要な熱重合を阻止するために少量の熱重合禁止剤を添 加することが望ましい。適当な熱重合禁止剤としては、 ハイドロキノン、p-メトキシフェノール、ジーt-ブ チルーp-クレゾール、ピロガロール、t-ブチルカテ コール、ベンゾキノン、4,4′ーチオビス(3-メチ ルー6-t-ブチルフェノール)、2, 2'-メチレン ピス (4-メチル-6-t-ブチルフェノール)、N-30 ニトロソフェニルヒドロキシルアミン第一セリウム塩、 N-ニトロソフェニルヒドロキシルアミンアルミニウム 塩等が挙げられる。熱重合禁止剤の添加量は、本発明の 製造方法で得られる感光性平版印刷版の光重合層組成物 の全成分の重量に対して、約0.01%~約5%が好ま しい。また必要に応じて、酸素による重合阻害を防止す るためにベヘン酸やベヘン酸アミドのような高級脂肪酸 誘導体等を添加して、塗布後の乾燥の過程で光重合層の 表面に偏在させてもよい。高級脂肪酸誘導体の添加量 は、本発明の製造方法で得られる感光性平版印刷版の光 重合層組成物の全成分の重量に対して、約0.5%~約 10%が好ましい。

【0124】更に光重合層の着色を目的として、着色剤 を添加してもよい。着色剤としては、例えば、フタロシ アニン系顔料 (C. I. Pigment Blue 15:3、15:4、 15:6など)、アゾ系顔料、カーボンブラック、酸化チ タンなどの顔料、エチルバイオレット、クリスタルバイ オレット、アゾ染料、アントラキノン系染料、シアニン 系染料がある。染料および顔料の添加量は、本発明の製 造方法で得られる感光性平版印刷版の光重合層組成物の グリコールモノブチルエーテルアセテート、3-メトキ 50 全成分の重量に対して、約0.5%~約5%が好まし

【0125】加えて、硬化皮膜の物性を改良するため に、無機充填剤やジオクチルフタレート、ジメチルフタ レート、トリクレジルホスフェート等の可塑剤等の添加 剤を加えてもよい。これらの添加量は本発明の製造方法 で得られる感光性平版印刷版の光重合層組成物の全成分 の重量に対して10%以下が好ましい。本発明の製造方 法で用いられる光重合層塗布液には、塗布面質を向上す るために界面活性剤を添加することができる。

【0126】上記のような光重合層塗布液中の固形分の 10 濃度は、1~50重量%が適当である。本発明の製造方 法で得られる感光性平版印刷版において光重合層の被覆 量は塗布乾燥後の重量で約0.1g/m<sup>2</sup>~約10g/ m'の範囲が適当である。より好ましくは0.3~5g /m<sup>²</sup>であり、更に好ましくは 0 . 5 ~ 3 g/m<sup>²</sup>であ

【0127】本発明の感光性平版印刷版の製造におい て、上記のような光重合層塗布液を塗布するための支持 体としては、寸度的に安定な板状物が用いられる。該寸 度的に安定な板状物としては、紙、プラスチック(例え 20 ばポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレンなど) がラミネートされた紙、また、例えばアルミニウム(ア ルミニウム合金も含む。)、亜鉛、銅などのような金属 の板、さらに、例えば二酢酸セルロース、三酢酸セルロ ース、プロピオン酸セルロース、酪酸セルロース、酪酸 酢酸セルロース、硝酸セルロース、ボリエチレンテレフ タレート、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリプロピレ ン、ポリカーボネート、ポリビニルアセタールなどのよ うなプラスチックのフィルム、上記の如き金属がラミネ ートもしくは蒸着された紙もしくはプラスチックフィル 30 ムなどが挙げられる。これらの支持体のうち、アルミニ ウム板は寸度的に著しく安定であり、しかも安価である ので特に好ましい。更に、特公昭48-18327号に 記載されているようなポリエチレンテレフタレートフィ ルム上にアルミニウムシートが結合された複合体シート も好ましい。

【0128】また金属、特にアルミニウムの表面を有す る支持体の場合には、砂目立て処理、珪酸ソーダ、弗化 ジルコニウム酸カリウム、燐酸塩等の水溶液への浸漬処 理、あるいは隔極酸化処理などの表面処理がなされてい 40 ることが好ましい。さらに、砂目立てしたのちに珪酸ナ トリウム水溶液に浸漬処理されたアルミニウム板が好ま しく使用できる。特公昭47-5125号に記載されて いるようにアルミニウム板を陽極酸化処理したのちに、 アルカリ金属珪酸塩の水溶液に浸漬処理したものが好適 に使用される。上記陽極酸化処理は、例えば、燐酸、ク 口ム酸、硫酸、硼酸等の無機酸、若しくは蓚酸、スルフ ァミン酸等の有機酸またはそれらの塩の水溶液又は非水 溶液の単独又は二種以上を組み合わせた電解液中でアル ミニウム板を陽極として電流を流すことにより実施され 50 アミン、トリエチルアミン、モノイソプロピルアミン、

る。

【0129】また、米国特許第3,658,662号に 記載されているようなシリケート電着も有効である。更 に、特公昭46-27481号、特開昭52-5860 2号、特開昭52-30503号に開示されているよう な電解グレインを施した支持体に、上記陽極酸化処理お よび珪酸ソーダ処理を組合せた表面処理をしたものも有 用である。また、特開昭56-28893号に開示され ているような機械的粗面化、化学的エッチング、電解グ レイン、陽極酸化処理、さらに珪酸ソーダ処理を順に行 ったものも好適である。

【0130】更に、これらの処理を行った後に、水溶性 の樹脂、たとえばボリビニルホスホン酸、スルホン酸基 を側鎖に有する重合体および共重合体、ポリアクリル 酸、水溶性金属塩(例えば硼酸亜鉛)もしくは、黄色染 料、アミン塩等を下塗りしたものも好適である。更に、 特開平7-159983号に開示されているようなラジ カルによって付加反応を起し得る官能基を共有結合させ たゾルーゲル処理基板も好適に用いられる。これらの親 水化処理は、支持体の表面を親水性とするために施され る以外に、その上に設けられる光重合層の組成物の有害 な反応を防ぐため、且つ光重合層の密着性の向上等のた めに施されるものである。

【0131】支持体上に設けられた光重合層の上には、 空気中の酸素による重合禁止作用を防止するため、例え ばポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、酸性 セルロース類などのような酸素遮断性に優れたポリマー よりなる保護層を設けてもよい。このような保護層の塗 布方法については、例えば米国特許第3、458、31 11号、特開昭55-49729号に詳しく記載されて いるが、本発明の方法では、特に、感光性平版印刷版の 温度を50℃以下に冷却した後に行うことにより、塗布 ムラのない状態で形成することができる。感光性平版印 刷版の温度が50℃を超えた状態で、前記酸素遮断性層 した場合には塗布ムラが生じ、酸素遮断性が悪くなる。 【0132】本発明の感光性平版印刷版は、画像形成の ため、Arレーザー、YAG-SHGレーザー等により 直接画像露光される。画像露光を行った後、現像処理を 行う。かかる現像処理に使用される現像液としては従来 より知られているアルカリ水溶液が使用できる。例え ば、ケイ酸ナトリウム、同カリウム、第三リン酸ナトリ ウム、同カリウム、同アンモニウム、第二リン酸ナトリ ウム、同カリウム、同アンモニウム、炭酸ナトリウム、 同カリウム、同アンモニウム、炭酸水素ナトリウム、同 カリウム、同アンモニウム、ほう酸ナトリウム、同カリ ウム、同アンモニウム、水酸化ナトリウム、同アンモニ ウム、同カリウムおよび同リチウムなどの無機アルカリ 剤が挙げられる。また、モノメチルアミン、ジメチルア ミン、トリメチルアミン、モノエチルアミン、ジエチル

ジイソプロピルアミン、トリイソプロピルアミン、n-ブチルアミン、モノエタノールアミン、ジエタノールア ミン、トリエタノールアミン、モノイソプロパノールア ミン、ジイソプロパノールアミン、エチレンイミン、エ チレンジアミン、ピリジンなどの有機アルカリ剤も用い られる。これらのアルカリ剤は単独もしくは二種以上を 組み合わせて用いられる。

【0133】上記のアルカリ水溶液の内、本発明による 効果が一段と発揮される現像液はアルカリ金属ケイ酸塩 を含有する p H 1 2 以上の水溶液である。アルカリ金属 10 ケイ酸塩の水溶液はケイ酸塩の成分である酸化ケイ素Si 0<sub>2</sub> とアルカリ金属酸化物M<sub>2</sub> 0の比率(一般に〔Si 0<sub>2</sub>〕/ [M, 0] のモル比で表す)と濃度によって現像性の調節 が可能であり、例えば、特開昭54-62004号公報 に開示されているような、SiO、/Na、Oのモル比が1.0 ~1. 5 (即ち (SiO<sub>2</sub>) / (Na<sub>2</sub>O) が1. 0~1. 5) であって、SiO,の含有量が1~4重量%のケイ酸ナトリ ウムの水溶液や、特公昭57-7427号公報に記載さ れているような、 $(SiO_2)$  / (M) が $0.5\sim0.75$ (即ち [SiO<sub>1</sub>] / [M<sub>2</sub>0] が1.0~1.5) であっ て、SiO,の濃度が1~4重量%であり、かつ該現像液が その中に存在する全アルカリ金属のグラム原子を基準に して少なくとも20%のカリウムを含有している、アル カリ金属ケイ酸塩の水溶液が好適に用いられる。

【0134】更に、自動現像機を用いて、該感光性平版 印刷版を現像する場合に、現像液よりもアルカリ強度の 高い水溶液(補充液)を現像液に加えることによって、 長時間現像タンク中の現像液を交換する事なく、多量の 感光性平版印刷版を処理することができることが知られ ている。本発明の方法によって得られる感光性平版印刷 30 版においてもこの補充方式が好ましく適用される。例え ば、特開昭54-62004号公報に開示されているよ うな現像液のSiO<sub>2</sub> /Na<sub>2</sub> Oモル比が1.0~1.5 (即ち  $(SiO_2) / (Na_2O) id_1 . 0 \sim 1. 5) canc. SiO_2$ の含有量が1~4重量%のケイ酸ナトリウムの水溶液を 使用し、しかも感光性平版印刷版の処理量に応じて連続 的または断続的にSiO, /Na, 0のモル比が 0. 5~1. 5 (即ち [SiO<sub>2</sub>] / [Na<sub>2</sub>0] が0.5~1.5) のケイ酸 ナトリウム水溶液(補充液)を現像液に加える方法、更 には、特公昭57-7427号公報に開示されている。 [SiO<sub>2</sub>] / [M] が0.5~0.75 (即ち [SiO<sub>2</sub>] / [M,0] が1.0~1.5) であって、SiO<sub>2</sub>の濃度が1 ~4重量%であるアルカリ金属ケイ酸塩の水溶液を現像 液として用い、補充液として用いるアルカリ金属ケイ酸 塩の [SiO<sub>2</sub>] / [M] が0.25~0.75 (即ち、  $[SiO_2]$  /  $[M_2O]$  が  $0.5 \sim 1.5$ ) であり、かつ該 現像液および該補充液のいずれもがその中に存在する全 アルカリ金属のグラム原子を基準にして少なくとも20 %のカリウムを含有していることを特徴とする現像方法

が好適に用いられる。

【0135】このようにして現像処理された感光性平版 印刷版は特開昭54-8002号、同55-11504 5号、同59-58431号等の各公報に記載されてい るように、水洗水、界面活性剤等を含有するリンス液、 アラビアガムや澱粉誘導体等を含む不感脂化液で処理さ れる。本発明の感光性平版印刷版から製版された平版印 刷版の後処理にはこれらの処理を種々組み合わせて用い ることができる。

【0136】現像後またはさらに任意に上記の不感脂化 処理等の後処理を行った後、先に述べた方法により全面 露光を行い、このようにして得られた平版印刷版はオフ セット印刷機に掛けられ、多数枚の印刷に用いられる。 印刷時、版上の汚れ除去のため使用するプレートクリー ナーとしては、従来より知られているPS版用プレート クリーナーが使用され、例えば、CL-1、CL-2、CP、CN-4、CN、CG-1、PC-1、SR、IC (富士写真フイルム株式会 社製)等が挙げられる。好ましくは、CP、CN-4が挙げら れる。

[0137]

20

【実施例】以下、本発明を合成例、実施例および比較例 によりさらに詳細に説明するが、本発明の内容がこれに より限定されるものではない。

合成例1:ポリウレタン樹脂

コンデンサー、攪拌機を備えた500mlの3つ口丸底 フラスコに2, 2-ビス(ヒドロキシメチル)プロピオ ン酸12.1g(0.09モル)、化合物No.5のジ オール化合物 (水酸基価56.9mgKOH/g) 2 0. 0g(0.01モル)をN, N-ジメチルアセトア ミド100mlに溶解した。これに4,4′-ジフェニ ルメタンジイソシアネート20.0g(0.08モ ル)、ヘキサメチレンジイソシアネート3.4g(0. 02g)を添加し、100℃にて5時間加熱攪拌した。 その後、N, N-ジメチルホルムアミド200mlおよ びメチルアルコール400mlにて希釈した。反応溶液 を水4リットル中に攪拌しながら投入し、白色のポリマ ーを析出させた。このポリマーを濾別し、水で洗浄後、 真空下乾燥させることにより45gの上記ポリマーを得 た。ゲルバーミエーションクロマトグラフィー(GP C) にて分子量を測定したところ、重量平均(ポリスチ 40 レン標準)で50,000であった。さらに滴定によ り、カルボキシル基含有量(酸価)を測定したところ、 1. 40meq/gであった。

【0138】合成例2:ポリウレタン樹脂 2, 2-ビス(ヒドロキシメチル)プロピオン酸18. 1g(0.14モル)、化合物例No.5のジオール化 合物 (水酸基価56.9mgKOH/g) 30.0g (0.02モル)をN, N-ジメチルアセトアミド10 0mlに溶解した。これに4,4′-ジフェニルメタン ジイソシアネート38、0g(0.16モル)を用い、 50 合成例1と同様にして反応後処理を行った。白色の上記

ボリマー80gを得た。GPCにより分子量を測定したところ重量平均(ボリスチレン標準)で200, 000であった。また滴定により、カルボキシル基含有量(酸価)を測定したところ、1.30meq/gであった。 [0139] 実施例 $1\sim3$ 、比較例 $1\sim3$ 

厚さ0.30mmのアルミニウム板をナイロンブラシと400メッシュのパミストンの水懸濁液とを用いその表面を砂目立てした後、良く水で洗浄した。10重量%水酸化ナトリウムに70℃で60秒間浸漬してエッチングした後、流水で水洗後20重量%硝酸で中和洗浄し、次10いで水洗した。これをVa=12.7Vの条件下で正弦波の交番波形電流を用いて1重量%硝酸水溶液中で160クローン/dm'の陽極時電気量で電解粗面化処理を行った。その表面粗さを測定したところ、0.6μm(Ra表示)であった。引き続いて30重量%の硫酸水

溶液中に浸漬し55℃で2分間デスマットした後、20 '重量%硫酸水溶液中、電流密度2A/dm'において、 陽極酸化被膜の厚さが2.7g/m'になるように、2 分間陽極酸化処理した。

【0140】このように処理されたアルミニウム板上に、下記に示す組成の光重合層塗布液を、ワイヤーバーを用いて乾燥塗布重量が1.50g/m²となるよう塗布した。このアルミニウム板の裏面に熱電対温度センサーを粘着テープで貼付けた後、楠本化成(株)製高温熱風乾燥オーブンETAC HT220中で乾燥させて光層を形成した。この時の乾燥条件と、貼付けた温度センサーにより測定したアルミニウム板支持体の温度を表2に示す。

[0141]

#### 光重合層塗布液の組成(A)

ペンタエリスリトールテトラアクリレート	1.	5		g
ポリウレタン樹脂バインダー(合成例1)	2.	0		g
下記構造の増感染料Dye-1	0.	1		g
下記構造の光重合開始剤S-1	0.	2		g
フッ素系ノニオン界面活性剤	0.	0	3	g
銅フタロシアニン顔料(有機ボリマー分散)	0.	1		g
メチルエチルケトン	2 0	•	0	g
プロピレングリコールモノメチルエーテル	2 0		0	g
1/4.2.41				

[0142]

#### 【化34】

#### 增感染料 Dye-1

$$(C_2H_5)_2N$$
 $C_4H_9$ 
 $C_4H_9$ 
 $C_4H_9$ 

# 光重合開始剤 S-1

【0143】この光重合層を形成した後、一旦50℃以下に冷却した後、該光重合層上にボリビニルアルコール(ケン化度 $86.5\sim89$ モル%、重合度1000)の $3重量%の水溶液を乾燥塗布重量が<math>2g/m^2$ となるように塗布し、100℃で90秒間乾燥させた。

【0144】このブレートをCymbolic Sci ences社製FD-YAGレーザーブレートセッター Plate Jet4を用いて露光量260設定(版面 50

光強度 0. 17 m J / c m²) 1. 000 D P I、de fault 条件で100線/inchの網点画像露光を行った後、富士写真フィルム(株)製デジタルプレートプロセッサーLP-850 Pに、富士写真フィルム

(株) 製現像液LP-D(10倍 水希釈液)を仕込み 現像処理し、その現像性を評価した。画像露光した通り に画像部が得られたものを○とし、画像露光した通りに 画像部が得られなかったものを×とし、表2に示した。

また、塗布乾燥後のプレートを50℃-40%の条件下 で3日間保存後、同様に露光現像し、強制経時保存後の 現像性を同様に評価した。また、得られた各印刷版を用 いてハイデルベルグ社製KORD型印刷機で市販のイン

キにて上質紙に印刷した。各印刷版の耐刷枚数を表2に '合わせて示す。

[0145]

【表2】 表 2

	実施例1	実施例 2	実施例3	比較例1	比較例 2	比較例 2
乾燥設定温度	120°C	140°C	110°C	90°C	150℃	150℃
乾燥時間	75 秒	45 秒	120秒	180秒	60 秒	120 秒
最高到達温度	118°C	128°C	109°C	89°C	142℃	143℃
90~140℃に 保たれた時間	42 秒	22 秒	60 秒	なし	38 秒	100秒
現像性	0	0	0	0	0	×
50℃-40%で 3 日間 保存後の現像性	0	0	0	0	×	××
耐刷枚数	20万	20万	19万	10万	20万	_

#### 【0146】実施例4~6

前述の実施例および比較例において光重合層塗布液を下 20 の印刷版を同様に印刷した時の各印刷版の耐刷枚数と 記の組成(B)に変更する以外は上記実施例1~3と同 様にして感光性平版印刷版を得、同様にPlate J e t 4を用いて画像露光を行った後、現像処理を行い印

刷版を得た。現像性の評価を同様に行いその結果と、そ を、表3に示す。

[0147]

#### 光重合層塗布液の組成 (B)

トリメチロールプロパントリアクリレート	2.	0	g
ポリウレタン樹脂バインダー(合成例2)	2.	0	g
増感染料Dye-1	0.	1	g
光重合開始剤S-1	0.	2	g
フッ素系ノニオン界面活性剤	0.	0	3 g
銅フタロシアニン顔料(有機ポリマー分散)	0.	1	g
メチルエチルケトン	20.	0	g
プロピレングリコールモノメチルエーテル	20.	0	g

#### 【0148】比較例4~5

[0150]

実施例1~3、比較例1~3において用いたものと同じ 表面処理を施したアルミニウム板支持体上に、下記の組 成(C)に示す光重合層塗布液を塗布し、表3に示す乾 燥条件で乾燥した後、実施例1~3と同様に、ポリビニ ルアルコールからなる層を設け、実施例1~3と同様に

レーザ露光した後、現像処理して比較例4,5の印刷版 を得た。現像性の評価を同様に行いその結果と、この印 刷版を用いて実施例1~3と同じ条件、方法で印刷した 時の耐刷枚数とを、表3に示す。

[0149]

#### 光重合層塗布液の組成 (C)

ペンタエリスリトールテトラアクリレート	1.	5	g
メタクリル酸20m01%とアリルメタクリレート	2.	0	g
80mo1%からなる線状共重合体 (Mw=4万)			
增感染料Dye−1	0.	1	g
光重合開始剤S-1	0.	2	g
フッ素系ノニオン界面活性剤	0.	0	3 g
銅フタロシアニン顔料(有機ポリマー分散)	0.	1	g
メチルエチルケトン	20.	0	g
プロピレングリコールモノメチルエーテル	20.	0	g
【表 3 】			

-	^
衩	3

	実施例 4	実施例 3	実施例 6	比較例 4	比較例 5
乾燥設定温度	120°C	140℃	110°C	120°C	90℃
乾燥時間	75秒	45秒	120秒	75秒	180秒
最高到達温度	118°C	128℃	109°C	118°C	89°C
90~140℃に 保たれた時間	42秒	22秒	60秒	42秒	なし
現像性	o,	0	0	0	0
50℃-40%で3日間 保存後の現像性	0	0	0	×	0
耐刷枚数	22万	21万	20万	8万	8万

【0151】上記の結果より、実施例1~6の方法で得 られた感光性平版印刷版は、バインダー成分としてポリ ウレタン樹脂を用い、光重合層の加熱乾燥が90~14 0℃の範囲で行われたことにより、現像性および耐刷性 のいずれにも優れていた。一方、比較例1の方法で得ら れた感光性平版印刷版は、現像性は良好であったが耐刷 20 いないことにより、光重合層の硬化が十分でなっかたた 性が劣っていた。これは、バインダー成分としてポリウ レタン樹脂を用いているが、光重合層の加熱乾燥が90 ~140℃の範囲で行われなかったことにより、光重合 層の硬化が十分でなっかたためと考えられる。また、比 較例2、3の方法で得られた感光性平版印刷版は、現像 性が不良であり印刷版を作成することができなかった。 これは、バインダー成分としてポリウレタン樹脂を用い ているが、光重合層の加熱乾燥時の最高到達温度が14 2℃および143℃と所定の範囲より高かっため、硬化 が過剰になり142  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  8 秒で経時後に、143  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  により、感度、耐刷性および保存安定性に優れたものと 100秒では製造直後から非画像部が現像液によって溶

解されなかったためと考えられる。さらに、比較例4お よび5の方法で得られた感光性平版印刷版は、現像性は 良好であったが耐刷性が劣っていた。比較例4では、光 重合層の加熱乾燥が90~140℃の範囲で行われてい るが、バインダー成分としてポリウレタン樹脂を用いて めと考えられる。比較例4では、バインダー成分として ポリウレタン樹脂を用いておらず光重合層の加熱乾燥も 90~140℃の範囲で行われなかったことにより、光 重合層の硬化が十分でなっかたと考えられる。

#### [0152]

【発明の効果】本発明の感光性平版印刷版は、光重合層 のバインダー成分としてポリウレタン樹脂を用い、光重 合層の塗布後の加熱乾燥を感光性平版印刷版の温度が9 0~140℃のに保持されるような条件で製造したこと なった。

#### フロントページの続き

#### (72)発明者 東 達治

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写 真フイルム株式会社内

Fターム(参考) 2H025 AA00 AA01 AA12 AB03 AC01

AC08 AD01 BC31 BC51 CB22

CC03 DA04 EA10 FA03 FA17

2H096 AA07 AA08 BA05 BA20 CA12

CA20 EA02 EA04 GA08

2H114 DA33 DA51 DA52 DA60 DA78

EA03 EA10 GA34 GA38